

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成23年10月20日 (2011.10.20)

【公表番号】特表2010-537868(P2010-537868A)

【公表日】平成22年12月9日 (2010.12.9)

【年通号数】公開・登録公報2010-049

【出願番号】特願2010-524186(P2010-524186)

【国際特許分類】

B 2 9 C 33/38 (2006.01)

B 2 9 C 33/64 (2006.01)

C 0 8 G 77/04 (2006.01)

【F I】

B 2 9 C 33/38

B 2 9 C 33/64

C 0 8 G 77/04

【手続補正書】

【提出日】平成23年8月31日 (2011.8.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

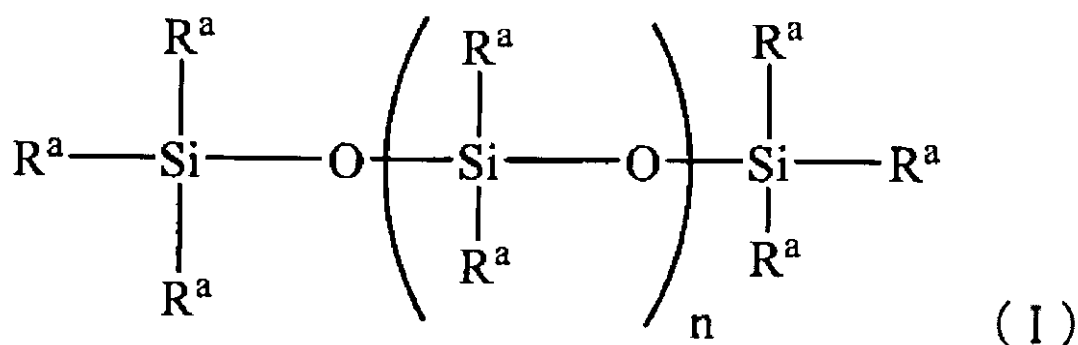
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

加工用成形型を形成する方法であって、
 少なくとも第 1 の構造化表面を有する基材を、チャンバ内の電極の近くに配置する工程と、
 前記電極に電力を供給してプラズマを発生させる工程と、
式 I の液体シリコン分子の蒸気を前記プラズマに導入する工程であって、
前記式 I は、

【化 1】



であり、

式中、 R^a は独立して、 H 、 OH 、アルキル、アリール、又はアルコキシであり、かつ n は 3 ~ 3000 の整数である、工程と、

シリコン含有ポリマーを含む剥離層を堆積させる工程であって、前記剥離層を前記基材の前記第 1 の構造化表面の少なくとも一部分上に堆積し、前記加工用成形型を形成する、工程と、を含む方法。

【請求項 2】

成形物品を形成する方法であって、

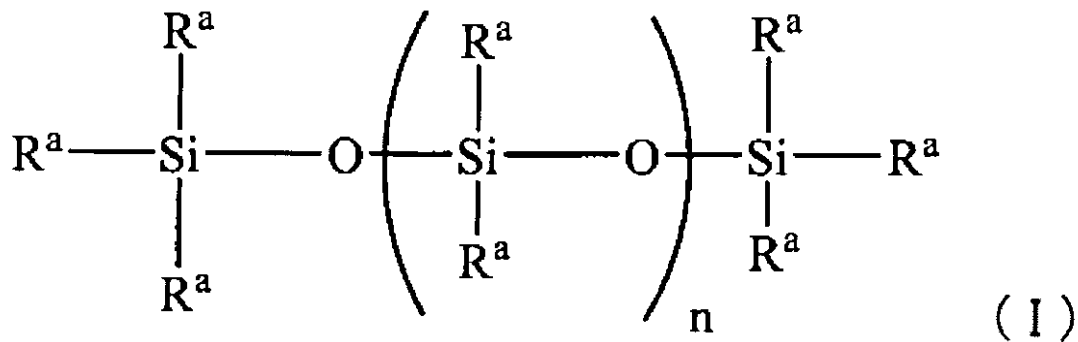
少なくとも第 1 の構造化表面を有する未処理の加工用成形型を、チャンバ内の電極の近くに配置する工程と、

前記電極に電力を供給してプラズマを発生させる工程と、

式 I の液体シリコン分子の蒸気を前記プラズマに導入する工程であって、

前記式 I は、

【化 2】



であり、

式中、 R^a は独立して、 H 、 OH 、アルキル、アリール、又はアルコキシであり、かつ n は 3 ~ 3000 の整数である、工程と、

シリコン含有ポリマーを含む剥離層を堆積させる工程であって、前記剥離層を前記第 1 の構造化表面の少なくとも一部分上に堆積して、前記加工用成形型を形成する、工程と、

第 3 世代の前駆体を前記加工用成形型の前記第 1 の表面の少なくとも一部分と接触させて、前記加工用成形型の前記第 1 の構造化表面の反転である成形物品を形成する工程と、を含む方法。

【請求項 3】

成形物品を連続して形成する方法であって、

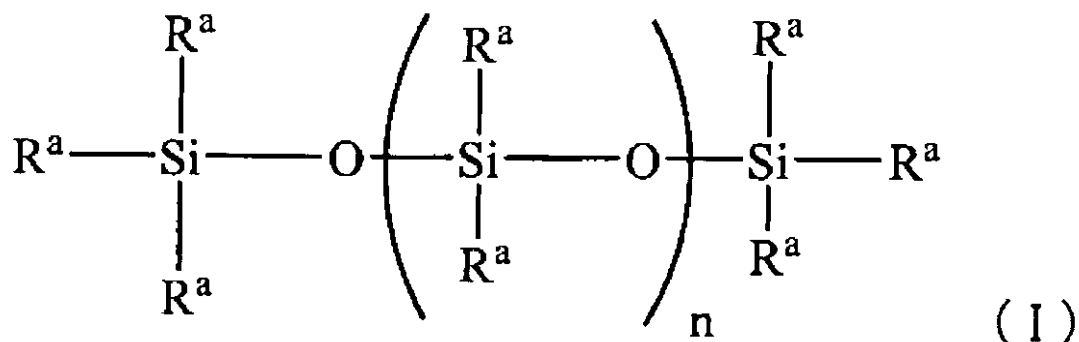
少なくとも第 1 の構造化表面を有する未処理の加工用成形型を、チャンバ内の電極の近くに配置する工程と、

前記電極に電力を供給してプラズマを発生させる工程と、

式 I の液体シリコン分子の蒸気を前記プラズマに導入する工程であって、

前記式 I は、

【化 3】



であり、

式中、 R^a は独立して、H、OH、アルキル、アリール、又はアルコキシであり、かつ
 n は3～3000の整数である、工程と、

シリコン含有ポリマーを含む剥離層を堆積させる工程であって、

前記剥離層を前記第1の構造化表面の少なくとも一部分上に堆積して、前記加工用成形
型を形成する、工程と、

前記加工用成形型を備える連続ツールを形成する工程と、

第3世代の前駆体を前記加工用成形型の前記第1の表面の少なくとも一部分と連続して
接触させて、前記加工用成形型の前記第1の構造化表面の反転である成形物品を形成する
工程と、を含む方法。